

集束型纳米薄膜生长系统

Cluster Deposition

CD4*100



实物图

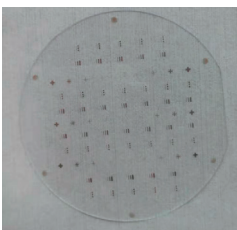
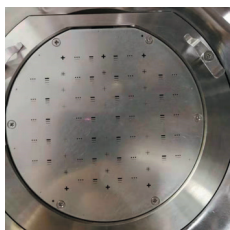
主要技术与性能指标

- 旋转式高真空传输系统
- 实现高真空 5×10^{-7} Torr 的高真空环境
- 薄膜生长实现原子级别的精准控制
- PVD/ALD 工艺平台的集成

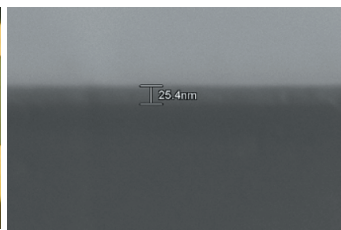
主要应用

全真空环境下器件制备

代表性应用成果



掩膜版装配实图和掩膜溅射样片



光学显微镜图片及侧面 SEM 显微镜图片

主要用户单位	中国科学院物理研究所、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
研制单位	中国科学院微电子研究所、嘉兴科民电子设备技术有限公司
联系方式	何萌 010-82995592, 13581817539 hemeng@ime.ac.cn